



KrFスキャナー

# NSR-S210D

タンデムステージ搭載により  
20%の生産性向上を実現



# 毎時176枚の高スループットで、 110 nm以下のデバイス量産に対応

## KrFスキャナー NSR-S210D

「NSR-S210D」は、実績あるタンデムステージの搭載により、生産性を従来機種比20%向上させたKrFスキャナーです。300 mmウェハで毎時176枚という高スループットを実現し、アライメント精度も9 nm以下にまで改善。110 nm以下のデバイス量産を、高生産性、高精度で実現します。

### 特長

#### ●ニコン独自の技術であるタンデムステージ採用により、

##### 高スループット、高精度を実現

ArF液浸スキャナーで実績のあるニコン独自のタンデムステージを搭載。露光と計測2つのステージで構成され、毎時176枚という高スループットを実現、高頻度で行われるキャリブレーションにより装置安定性も高めています。

#### ●卓越した結像性能

NA 0.82の投影光学系と照明系により優れた結像性能を発揮し、フレアも少なく温度変化にも影響を受けにくい光学系を構築しています。

#### ●CoO (Cost of Ownership) を大幅に低減

タンデムステージの採用による高スループットの実現や長期安定性、ならびに量産で実績を積んだ結像性能が、CoO低減に大きく寄与します。

#### ●共通プラットフォーム化によるランニングコスト削減

NSR-S210Dの開発により、ニコンのスキャナー全機種が共通プラットフォーム上で構築され製造効率が向上し、ランニングコストの削減が可能となります。タンデムステージのプラットフォーム設計はデバイスメーカーにとって益々重要になってきた顧客先での据付時間の短縮にも寄与します。また、ソフトウェアを共通化することでフィールドでのサポートの簡略化も併せて実現しています。

### Performance

解像度	≤ 110 nm
NA	0.82
露光光源	KrF excimer laser (248 nm wavelength)
縮小倍率	1:4
最大露光範囲	26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度	≤ 9 nm
スループット	≥ 176 wafers/hour (76 shots)

クラス1レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### ご注意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

●このカタログは2018年11月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2018 NIKON CORPORATION

<http://www.nikon.co.jp/pec>

株式会社 **ニコン**

半導体装置事業部 事業企画部 108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 電話(03)6433-3639

株式会社 **ニコンテック** 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911